

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月6日(06.07.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/127690 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/038 (2006.01) *G03F 7/20* (2006.01)
G03F 7/004 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/047418

(22) 国際出願日: 2022年12月22日(22.12.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-214045 2021年12月28日(28.12.2021) JP

(71) 出願人: 東京応化工業株式会社 (TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者: 砂道 智成 (SUNAMICHI Tomonari); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 橋本 陽奈 (HASHIMOTO Haruna); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 平野 智之 (HIRANO Tomoyuki); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP). 中川 裕介 (NAKAGAWA Yusuke); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 田 ▲ 崎 ▼ 聡, 外 (TAZAKI Akira et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: RESIST COMPOSITION AND RESIST PATTERN FORMING METHOD

(54) 発明の名称: レジスト組成物、及び、レジストパターン形成方法

(57) Abstract: A resist composition comprising a resin (A), an acid generating agent (B), and a crosslinking agent (C), wherein the resin (A) is an alkali-soluble resin that has a molar absorbance coefficient of $2000 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$ or less at a wavelength of 248 nm, and the crosslinking agent (C) is at least one crosslinking agent selected from the group consisting of melamine-based crosslinking agents, urea-based crosslinking agents, alkylene urea-based crosslinking agents, glycoluril-based crosslinking agents, and epoxy-based crosslinking agents.

(57) 要約: 樹脂 (A) と、酸発生剤 (B) と、架橋剤 (C) とを含有し、樹脂 (A) は、波長 248 nm のモル吸光係数が $2000 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$ 以下であるアルカリ可溶性樹脂であり、架橋剤 (C) は、メラミン系架橋剤、尿素系架橋剤、アルキレン尿素系架橋剤、グリコールウルル系架橋剤、およびエポキシ系架橋剤からなる群から選ばれる少なくとも1種の架橋剤である、レジスト組成物。



WO 2023/127690 A1